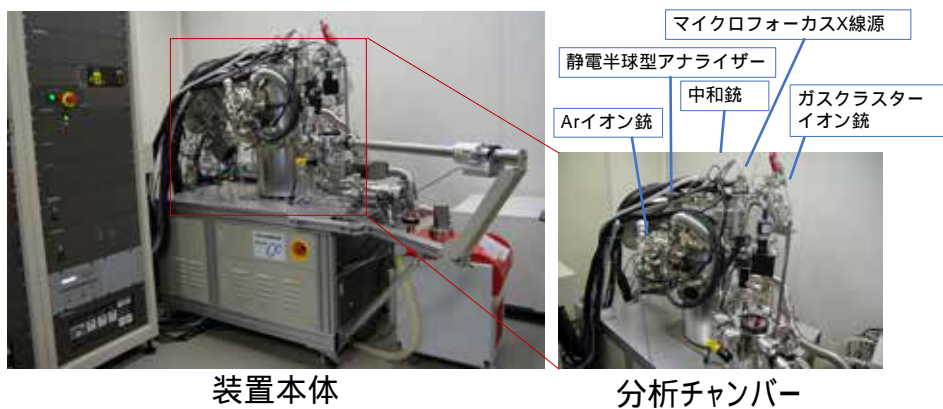


「マイクロX線光電子分光分析装置」の紹介

本装置は、試料表面にX線を照射し、放出される光電子のエネルギーを測定することにより、表面から数nm程度の極表面の元素組成を分析することができます。照射X線を集光することにより10 μ mの微小領域の測定が可能です。



装置本体

分析チャンバー

メーカー・型式

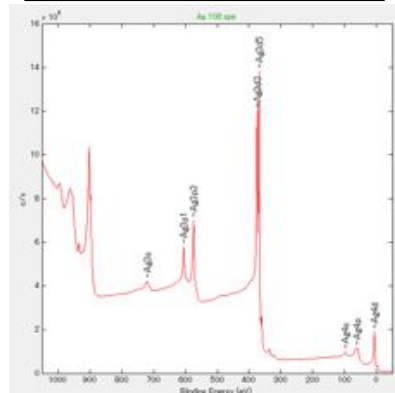
- ・メーカー：アルバック・ファイ株式会社
- ・型式：PHI5000 VersaProbe

<主な仕様>

- ・走査型マイクロフォーカスX線源 アノード：Al、最小X線ビーム径：10 μ m、走査範囲：1.4mm
- ・エネルギー分析部：静電半球型エネルギーアナライザー、32chマルチチャンネルディテクタ
- ・デュアルアノードX線源 アノード：Mg/Zr
- ・帯電中和：低エネルギー電子線とイオンビームの同時照射
- ・イオンエッチング：Arイオン銃、Arガスクラスターイオン銃
- ・分析方法：定性・簡易定量分析、デプス分析、状態分析等

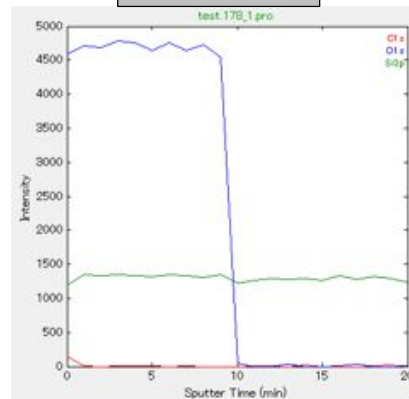
X線光電子分光分析でわかること

定性・簡易定量分析



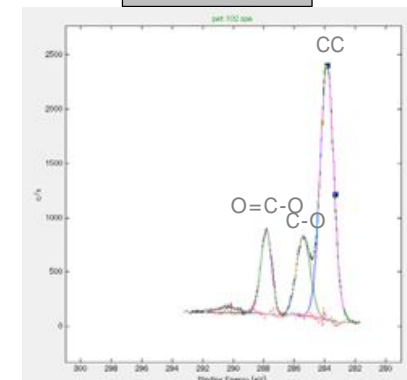
ピーク位置と強度から定性・簡易定量分析が可能

デプス分析



測定とエッチングを繰り返すことにより、深さ方向の組成分布の分析が可能

状態分析



元素ピークを波形分離することにより化学的結合状態の分析が可能